

令和2年度戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)に2事業が採択

～財団と(株)伏見製薬所がヒト皮膚マイクロバイオームのバランス維持による悪玉菌の活性抑制型皮膚用剤の高精度生産技術を共同開発～
 ～財団と(株)レクザムが次世代半導体プロセスに対応可能な超臨界技術を用いたウエハ乾燥技術を共同開発～

戦略的基盤技術高度化支援事業とは

わが国製造業の国際競争力強化と新たな事業の創出を目指し、中小企業・小規模事業者によるものづくり基盤技術(12技術分野)の向上につながる研究開発、その事業化に向けた取組を支援することを目的とし、製品化につながる可能性の高い研究開発、試作品開発等及び販路開拓への取組を一貫して支援するものです。

※ものづくり基盤技術(12技術分野):デザイン開発技術/情報処理技術/精密加工技術/製造環境技術/接合・実装技術/立体造形技術/表面処理技術/機械制御技術/複合・新機能材料技術/材料製造プロセス技術/バイオ技術/測定計測技術

令和2年度事業に採択!

今年度は1月31日～4月24日まで公募が実施され、当財団からは申請した2件が採択されました。全国では、326件の申請があった中から102件(四国は3件)が採択されました。

採択案件

研究テーマ	内容	基盤技術	実施体制
ヒト皮膚マイクロバイオームのバランス維持による悪玉菌の活性抑制型皮膚用剤の高精度生産技術の開発	ヒトに安全でヒトの皮膚に常在する菌群である細菌叢(マイクロバイオーム)のバランスを壊さずに目的の菌の生育のみを抑制する全く新しいタイプのメチル-L-ソルボシドの誘導体である各種アルキル-L-ソルボシドを用いた、ニキビおよび加齢臭の悪化要因菌等の生育抑制と皮膚細菌叢のバランス維持の両立を可能とする次世代型皮膚用剤の高精度生産技術の開発を行う。	材料製造プロセス	(公財)かがわ産業支援財団 株式会社伏見製薬所 国立大学法人九州大学 国立大学法人香川大学
次世代半導体プロセスに対応可能な超臨界技術を用いたウエハ乾燥技術の開発	AI・IoT時代を迎え、半導体集積回路の超微細化が進むなか、従来の乾燥法では溶媒の表面張力により線幅の狭いパターンが倒壊するという問題が顕在化してきた。このため、表面張力が小さい超臨界二酸化炭素流体による高精度なウエハの乾燥法を開発する。乾燥速度の向上とコンタミ低減技術を開発し、産総研の評価技術を活用して、次世代のEUV露光装置を用いる300mmウエハ量産ラインに組み込み可能な仕様を目指す。	材料製造プロセス	(公財)かがわ産業支援財団 株式会社レクザム 国立研究開発法人産業技術総合研究所

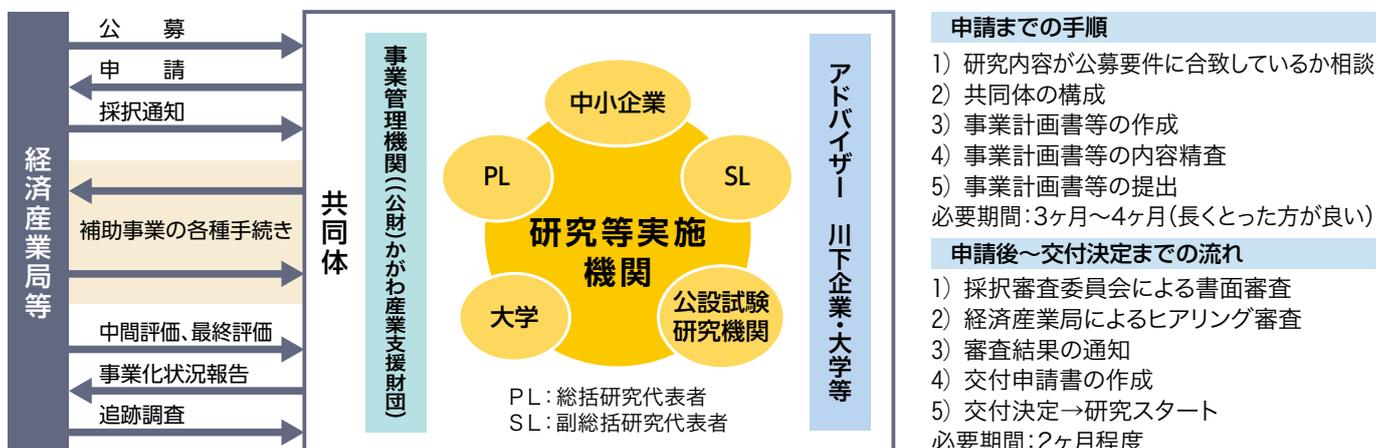
次年度以降の申請の相談について

本事業は、通常毎年1月～4月頃に公募が行われます。高度な技術開発を前提とし、新規性や具体的な効果等が厳密に審査されるため、採択されるには事業計画の作成等に十分な準備を必要とします。当財団では常時相談に応じています。本事業への申請を検討されている企業・大学・公設試験研究機関の方は、お早めにご連絡ください。

本事業の令和2年度公募要領では次のとおりでした。

補助事業期間	2年度又は3年度
補助金額(上限額)	1事業あたり 単年度4,500万円以下 2年度の合計で7,500万円以下 3年度の合計で9,750万円以下
補助率	2/3以内
申請要件	「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」に関する研究開発であり、中小企業者を含む共同体を構成すること。

事業スキーム図



お問い合わせ先

公益財団法人かがわ産業支援財団 技術振興部 産学官連携推進課
 高松市林町2217-16 FROM香川1F TEL.087-840-0338 FAX.087-864-6303